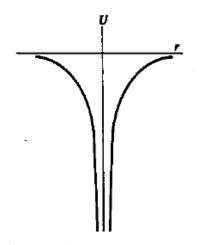
Kap. 14:

Elektronen im periodischen Potential: Bandstrukturen

- 1. Allgemeine Eigenschaften: Bandstruktur, Energielücke, Bloch-Zustände
- 2. Spezialfall Halbleiter: Bandstrukturen von Si, Ge, GaAs, intrinsisches Verhalten, Dotierung



14. Gitterpotential (1)



← Coulomb-Potential eines Atomrumpfes

Figure 7.1 The bare ion Coulomb potential.

Coulomb-Potential einer periodischen Anordnung von Atomrümpfen →

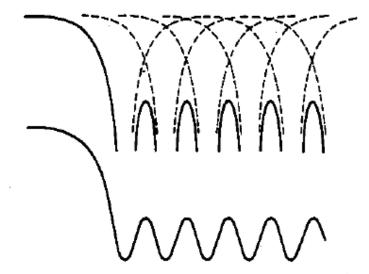
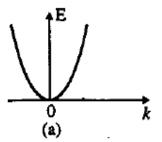
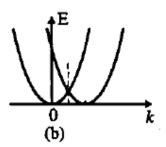


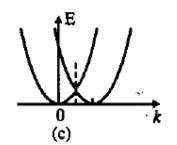
Figure 7.2 The electrostatic potential through a line of atoms in a crystal and parallel to such a line.

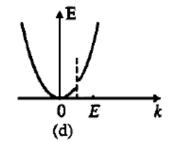


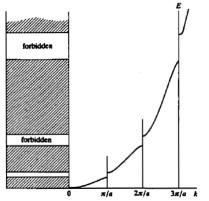
14. Ausgedehntes und reduziertes Zonenschema (6)

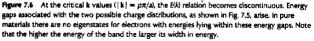




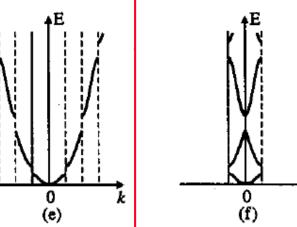




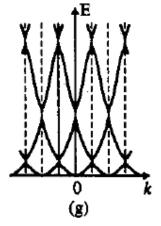








Reduziertes Zonenschema



Ausgedehntes Zonenschema



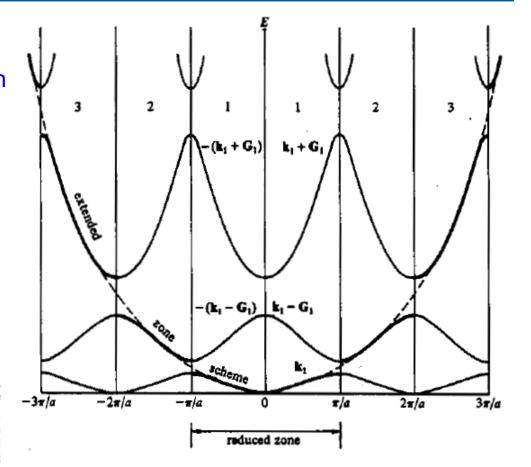
14. Bandstruktur und Zonenschema in 1D für schwaches Potential (7)

Dispersionsrelation E(k) häufig nahezu parabolisch, analog zu freien Elektronen → Definition einer effektiven Masse zur Anpassung an experimentellen Verlauf

$$E(k) = \frac{\hbar^2 k^2}{2 m_{eff}}$$

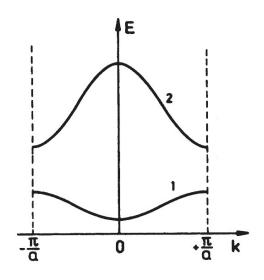
$$m_{eff} := \frac{\hbar^2}{d^2 E/dk^2}$$

Figure 7.7 This diagram illustrates the properties of a linear lattice, but it is also typical of behaviour along any symmetry direction in a three-dimensional crystal. If we plot E as a function of monotonically increasing k then we obtain the thick curve, which, for a weak periodic potential, closely resembles the free electron parabola. This is the extended zone scheme. However, just as in our discussion of phonons, we may redraw this curve from all the possible origins of the reciprocal lattice and this leads to a series of continuous curves arranged one upon the other and extending throughout the whole of **k** space. This description is called the *periodic zone scheme*. It is sufficient if we confine attention to the thick black curve, but this extends over all the zones, of which only three are shown in the figure. In principle the electron may have any energy and an excited electron (before it leaves the sample) may be in a state within say the tenth zone. The extended zone scheme is instructive but inconvenient. We therefore use the reduced zone, i.e. all states with $|\mathbf{k}| > \pi/a$ are translated an integral number of reciprocal lattice base vectors until they land in the first zone. Thus those states that are in the interval $-3\pi/a \le k \le -2\pi/a$ are shown as $-(k_1 + G_1)$, whereas those in the interval $2\pi/a \le k \le 3\pi/a$ are written as $k_1 + G_1$ and $0 \le |k_1| \le \pi/a$. All the possible k states may be remapped into the first zone; the description is known as the reduced zone scheme. The different bands may be numbered according to increasing energy. G₁ is the base vector of the reciprocal lattice.





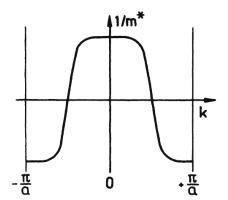
14. Effektive Masse (8)

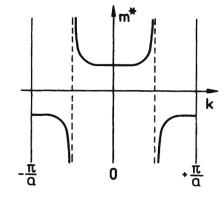


Typische Bandstruktur in 1D:

- E(k) = E(-k) wg. Inversionssymmetrie des Potentials
- Bänder und Bandlücken wechseln sich ab
- Positive und negative Krümmungen der Bänder für k=0 wechseln sich ab
- horizontale Tangenten im Zentrum und am Rand der Brillouin-Zone

Fig. 3.8 Struktur zweier Energiebänder mit der unteren (1) und der oberen (2) Bandgrenze bei k = 0





Effektive Masse für das erste Band:

- im Zonenzentrum nahezu konstant
 - → Band wird gut durch Parabel genähert
- zum Zonenrand hin starker Anstieg
 - → Bragg-Reflexion für k-Werte am Zonenrand kündigt sich an

Fig. 3.24 Reziproke effektive Masse $1/m^*$ und effektive Masse m^* eines Kristallelektrons als Funktion der Wellenzahl k für eine Energiefunktion E(k), die der Kurve 1 in Fig. 3.8 entspricht



14. Metalle, Halbmetalle, Halbleiter, Isolatoren (10)

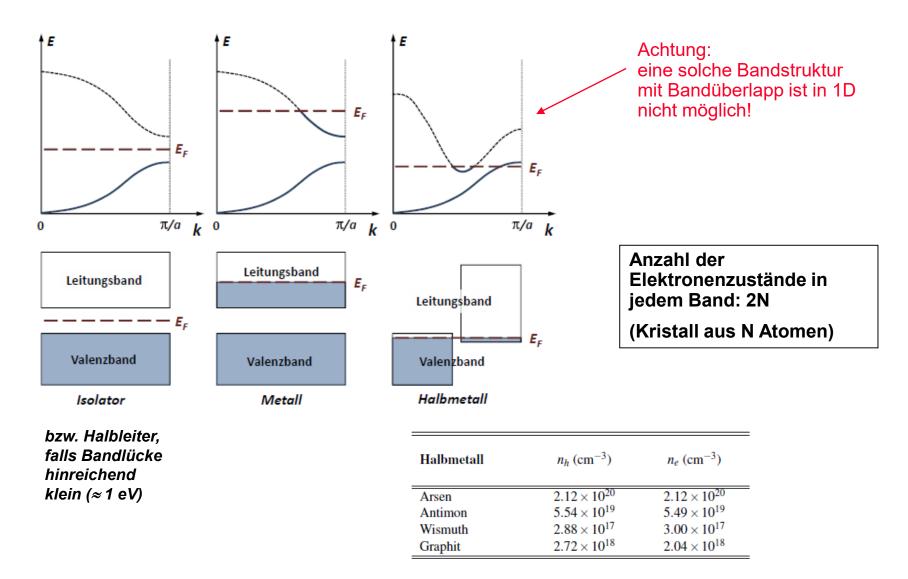




Tabelle 8.2: Ladungsträgerdichte von Halbmetallen.

14. Bandstruktur von Aluminium: fast freie Elektronen (13)

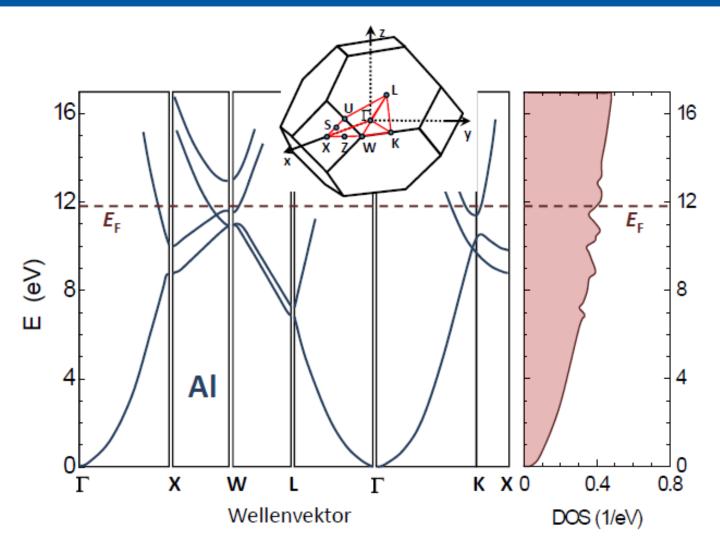


Abbildung 8.18: Bandstruktur von Aluminium entlang von Richtungen hoher Symmetrie (links). Der Γ Punkt ist das Zentrum der 1. Brillouin-Zone (siehe Inset). Die Bandlücken an der Zonengrenzen sind klein
und der Bandverlauf kann in weiten Teilen durch parabelförmige Kurven angenähert werden. Rechts ist die
Zustandsdichte D(E) gezeigt.



14. Fermiflächen von Metallen (16)

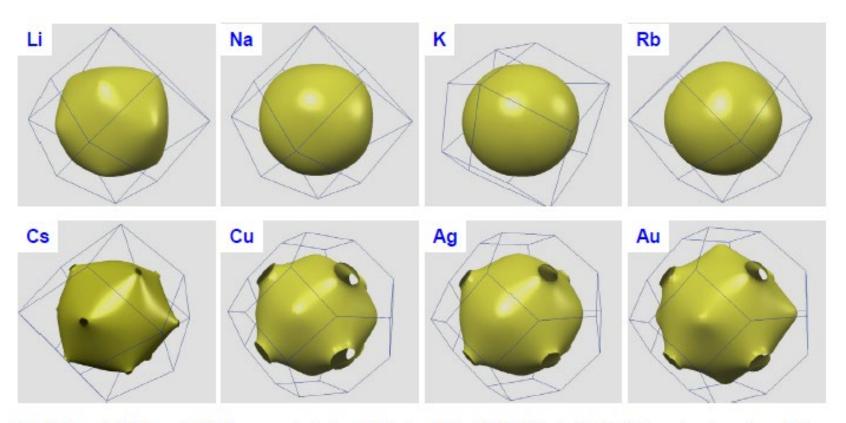


Abbildung 8.25: Fermi-Flächen von einfachen Metallen. Die Alkali-Metalle kristallisieren in einem bcc-Gitter, Cu, Ag und Au in einem fcc-Gitter (Quelle: Physics Department, University of Florida).

- Nur Elektronen an der Fermifläche bestimmen die elektrischen Eigenschaften!
- Bei Edelmetallen (Cu, Ag, Au) spielen dispersionsarme d-Bänder eine wichtige Rolle.
- Im allgemeinen ist die Fermifläche realer Metalle nicht exakt kugelförmig.



Erinnerung: Periodensystem der Elemente

	1		Da	riac	lan	21.00	ton	- d	-	Ela	ma	nto						18
1	1.01 H Wasserstoff	2	Per	104	ens	sys	teri		er	Elei	rie	nte	13	14	15	16	17	Helium
2	Li Li	9.01 Be Beryttum	Elementsymbol — C O — Gasförmige Elemente (20°C) B C N O F										18.998 F	Neon				
3	Na Nathum	Mg Mg	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Al Al Aluminium	Si Silicium	30.97 P Phosphor	32.07 S Schwefel	35.45 CI Chlor	39.95 Ar Argon
4	39.10 K	40.08 Ca	44.96 Sc	47.88 Ti	50.94 V	52.00 Cr	Mn	55.85 Fe	Co Cobalt	58.70 Ni	63.55 Cu	65.38 Zn	69.72 Ga	72.61 Ge	74.92 As	78.96 Se	79.90 Br	83.80 Kr
5	85.47 Rb	87.52 Sr	88.91 Y	91.22 Zr	92.91 Nb	95.94 Mo	(98) TC	101.07 Ru	102.91 Rh	106.42 Pd	107.87 Ag	112.41 Cd	114.82	118.71 Sn	121.76 Sb	127.60 Te	126.90	131.29 Xe
6	132.91 Cs	(STEEDS LEVEL)	La-Lu		180.95 Ta	Molybdán 183.84 W	186.21 Re	190.23 Os	192.22 Ir	Palladium 195.08 Pt	196.97 Au	200.59 Hg	204.38 TI	207.2 Pb	208.98 Bi	(209) P@	(210) (210)	(222) Rin
7	(223)	(226) Ra	Ac-Lr	(261)	(262)	(263) Sg	Rhenium (262)	(265) HS	(266)	(269)	Gold	Quecksilber	Thallium	Blei	Bismut	Polonium	Astat	Radon
	Francium Radium Rutherfordum Dubnium Seaborgium Behrium Hassium Meitnerium Dumestutium © Peter Wich - Experimentalchemie.de - Chemie erleben												e erleben!					

138.91	140.12	144.24	144.24	(145)	150.36	151.97	157.25	158.93	162.50	164.93	167.26	168.93	173.04	174.97
La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
Lanthan	Cer	Praseodym	Neodym	Promethium	Samarium	Europium	Gadolinium	Terbium	Dysprosium	Holmium	Erbium	Thulium	Ytterbium	Lutetium
227.03	232.04	231.04	238.03	(237)	(244)	(243)	(247)	(247)	(251)	(252)	(257)	(258)	(259)	(260)
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr
Actinium	Thorium	Protectinium	Uran	Neptunium	Plutonium	Americum	Curlum	Berkelium	Californium	Einsteinium	Fermium	Mondelevium	Nobelium	Lawrencium

14. Halbleiter (17)

Elektronische Geräte sind allgegenwärtig u. basieren auf Halbleitern:

Informationstechnik

Erzeugung, Modulation, Transport, Verarbeitung von Signalen



Energietechnik

Gleichrichtung von Wechselspannung, Wechselrichtung von Gleichspannung, Vernetzung fluktuierender Quellen, Echtzeitregelung

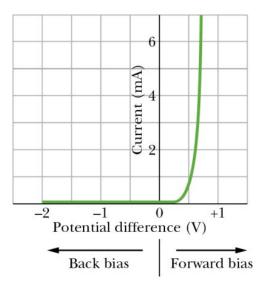




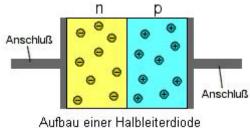
14. Halbleiter (18)

Basis: Bauelemente mit nicht-linearen Kennlinien

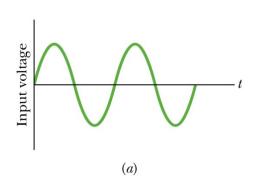
Beispiel: Diode

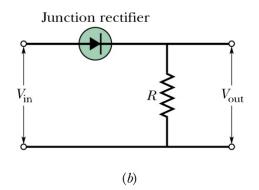


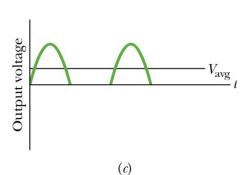
entspricht Ventil für elektrischen Strom



Anwendung u.a.: Gleichrichtung von Wechselstrom









14. Halbleiter (19)

Voraussetzungen:

- Material: Einstellbarkeit der Leitfähigkeit über viele Größenordnungen
 - intrinsischer Halbleiter: Ausgangsmaterial mit Bandlücke (nicht zu groß)
 - extrinsischer Halbleiter: Modifikation durch Fremdatome (= Dotierung)

(n-Dotierung, p-Dotierung)

- Bauelemente: Möglichkeit zur gezielten, temporären Veränderung
 - Steuern von Ladungsträgerdichten in räumlich abgegrenzten Bereichen durch elektrische Felder bzw. Ströme

Grenzflächeneffekte: pn-Übergang (Diode)

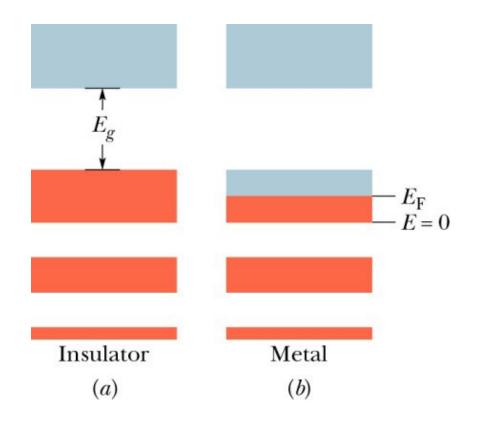
- Verstärkung von Signalen

Grenzflächeneffekte: npn- / pnp-Transistor Feldeffekt-Transistor

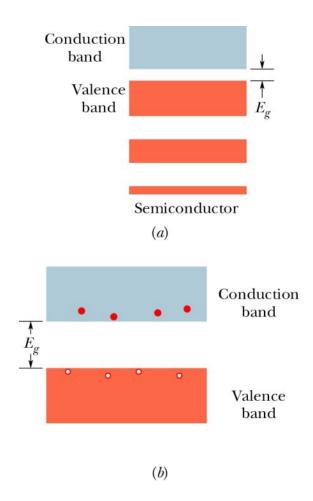


14. Intrinsische Halbleiter (20)

Bandstruktur der Festkörper:



Spezialfall Halbleiter:





14. Intrinsische Halbleiter (21)

Materialien mit vollkommen <u>gefüllten</u> und <u>leeren</u> Bändern:
Isolatoren und Halbleiter; Unterschied nur quantitativer, nicht qualitativer Art. Im (intrinsischen) Halbleiter gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, Ladungsträger thermisch über die Energielücke E_g zwischen besetztem Valenzband (VB oder V) und leerem Leitungsband (CB oder C: conduction band) anzuregen, aufgrund der thermischen Verschmierung der Fermi-Verteilungsfunktion.

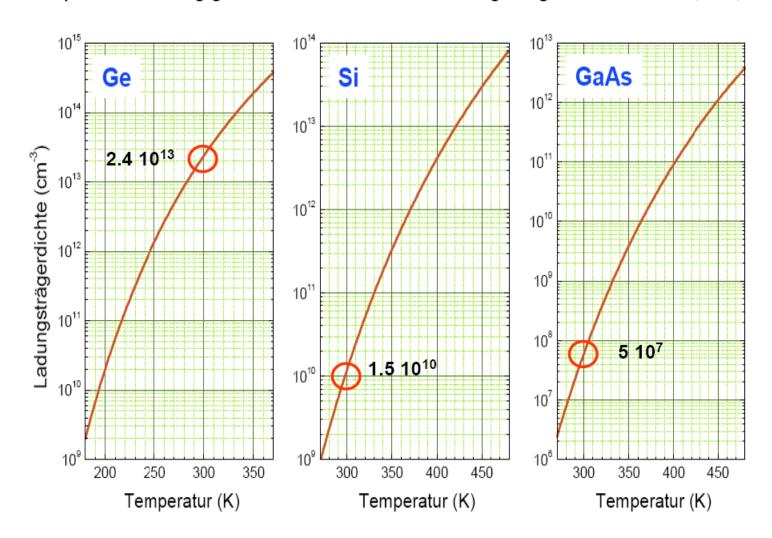
ightarrow Anteil thermisch angeregter Ladungsträger: $n_{therm} \sim \exp(-E_g/2k_BT)$ Bsp.: 300 K, $k_BT \cong 25$ meV; $E_g = 0.5$ eV $\Rightarrow n_{therm} \sim e^{-10} \sim 5\cdot 10^{-5}$

Sowohl thermisch angeregte El. im CB als auch therm. angeregte Löcher im VB führen zu einer endlichen Leitfähigkeit, d.h. zu Halbleiter-Verhalten. Halbleiter: i.a. $E_q < 2$ eV und $10^{-2} < \rho < 10^9~\Omega cm$.



14. Intrinsische Halbleiter (22)

Temperaturabhängigkeit der intrinsischen Ladungsträgerdichte von Si, Ge, GaAs





14. Materialien (23)

Elementhalbleiter:

- Si, Ge Diamantstruktur (IV. Hauptgruppe/Spalte im Periodensystem;
 4-fach, teraedrische Koordination)
 - Si: zentrale Rolle in der Mikro-und Nanoelektronik sowie Informationstechnologie!

Binäre oder Verbindungs-Halbleiter:

- III-V Halbleiter (z.B. GaAs: für Optoelektronik, schnelle Transistoren, Grundlagenforschung, wie Quanten-Hall-Effekt)
 Übergang Gruppe IV → III-V: chem. Bindung mit partiellem ionischen Charakter und damit Erhöhung der Energielücke;
- II-VI Halbleiter (z.B. ZnS, ZnTe, HgTe etc.)
 - Noch grössere Energielücke für II-VI Halbleiter

 (→ Anwendung für Displays und Laser);

 Ausnahme: HgTe (kleine Energielücke → Infrarotdetektoren)
- IV-VI Halbleiter (PbS, PbTe, SnS: kleine Energielücken → IR-Detektoren)



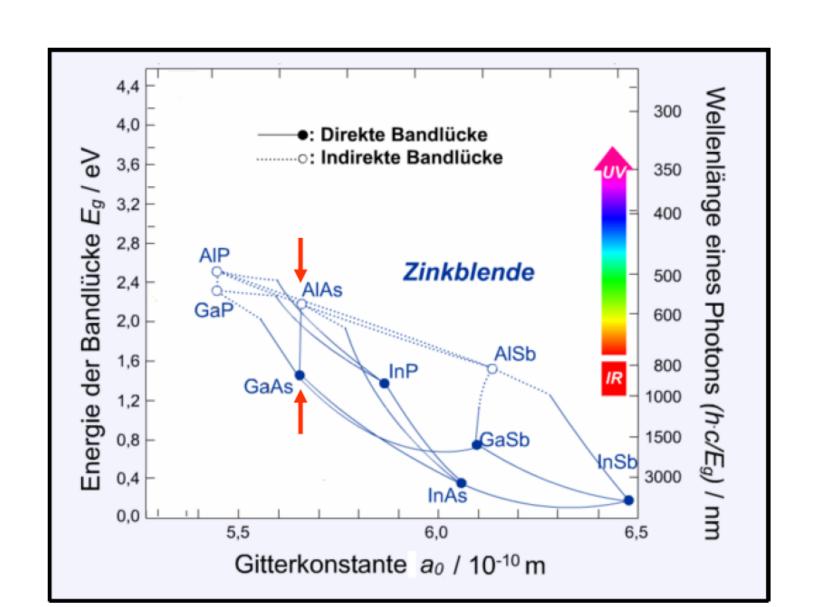
14. Bandlücken (24)

Halbleiter		E _g (0K) (eV)	E _g (300 K) (eV)	Halbleiter		E _g (0K) (eV)	E _g (300 K) (eV)
Si	indirekt	1.17	1.12	GaP	indirekt	2.32	2.26
Ge	indirekt	0.742	0.661	InP	direkt	1.421	1.344
GaAs	direkt	1.519	1.424	ZnO	direkt	3.44	3.2
InSb	direkt	0.24	0.17	ZnS	_	3.91	3.6
InAs	direkt	0.415	0.354	CdS	direkt	2.58	2.42
AlSb	indirekt	1.65	1.58	CdTe	direkt	1.61	1.45
GaN (Wurzit)	indirekt	3.47	3.39	GaN (ZnS)	direkt	3.28	3.20

Tabelle 10.2: Werte der Energielücken von einigen Halbleitern bei $T=0\,\mathrm{K}$ (linear extrapolierte Werte) und bei 300 K. Quelle: Handbook Series on Semiconductor Parameters, Vol. 1 and 2, edited by M. Levinstein, S. Rumyantsev and M. Shur, World Scientific, London (1996, 1999).

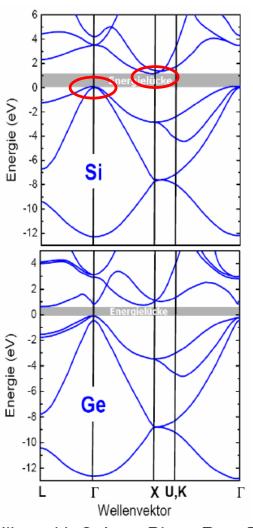


14. III-V-Halbleiter für die Optoelektronik (25)





14. Bandstruktur von Silizium u. Germanium (26)



sp³-Hybridorbitale mit Ausbildung von 2 Subbändern mit Energielücke; deren Aufspaltung nimmt ab mit zunehmendem Abstand der Atome, d.h. E_q nimmt ab mit zunehmender Temperatur

Si. indirekter Halbleiter mit $E_g(0 \text{ K})$ =1.17 eV zwischen Γ-Punkt und 0.8(Γ-X)

Ge: indirekter Halbleiter mit $E_g(0 \text{ K}) = 0.75 \text{ eV}$ zwischen Γ - und L-Punkt

Halbleiter	E _g (0 K) (eV)	E _g (300 K) (eV)	Halbleiter	E _g (0 K) (eV)	E _g (300 K) (eV)
Si	1.17	1.12	InP	1.42	1.35
Ge	0.75	0.67	ZnO	3.44	3.2
GaAs	1.52	1.43	ZnS	3.91	3.6
InSb	0.24	0.18	CdS	2.58	2.42
InAs	0.43	0.35	CdTe	1.61	1.45

Chelikowski, Cohen, Phys. Rev. B 14, 556 (1976)



14. Bandstruktur von GaAs (27)

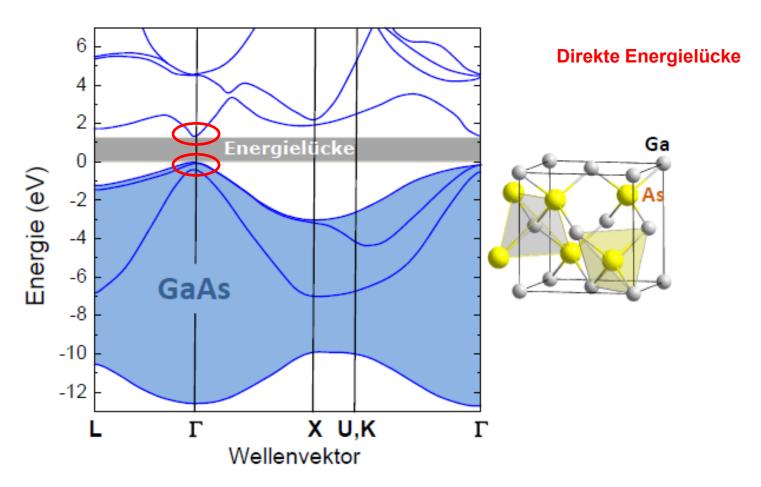


Abbildung 10.3: Berechnete Bandstrukturen von GaAs (nach J.R. Chelikowski und M.L. Cohen, Phys. Rev. B 14, 556 (1976)). Die vier Valenzbänder (unteres sp³-Subband) sind farbig hinterlegt. Rechts ist die Zinkblendestruktur von GaAs gezeigt.



14. Näherung der Bandstruktur in Halbleitern (28)

Approximation des Bandverlaufs an Oberkante E_V des VB bzw. Unterkante E_C des CB durch Parabel möglich:

$$E(\vec{k}) = E_C + \frac{\hbar^2}{2} \sum_{ij} k_i (\frac{1}{m^*})_{ij} k_j$$
 Elektronen

$$E(\vec{k}) = E_{v} - \frac{\hbar^{2}}{2} \sum_{ij} k_{i} \left(\frac{1}{m*}\right)_{ij} k_{j} \quad \text{L\"ocher}$$

Der effektive Massetensor $(\frac{1}{m^*})_{ij}$ ist reel und symmetrisch, d.h. können Satz

von orthogonalen Hauptachsen finden, bezgl. der die Energien Diagonalform haben $-\frac{\hbar^2}{\hbar^2} \frac{k^2}{k^2} \frac{k^2}{k^2}$

$$E(\vec{k}) = E_C + \frac{\hbar^2}{2} \left(\frac{k_x^2}{m_{xx}^*} + \frac{k_y^2}{m_{yy}^*} + \frac{k_z^2}{m_{zz}^*} \right)$$
 Elektronen

$$E(\vec{k}) = E_v - \frac{\hbar^2}{2} \left(\frac{k_x^2}{m_{xx}^*} + \frac{k_y^2}{m_{yy}^*} + \frac{k_z^2}{m_{zz}^*} \right)$$
 Löcher

Flächen konstanter Energie: Ellipsoide mit 3 Hauptachsen und 3 effektiven Massen;

für Rotationsellipsoide: definieren zwei effektive Massen

- longitudinal $m_{e,l}^*$
- transversal $m_{e,t}^*$



14. Effektive Masse bei Halbleitern (29)

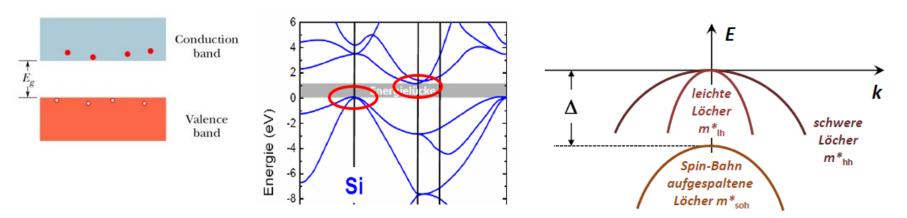


Abbildung 10.2: Qualitativer Verlauf der Bandstruktur von Si und Ge in der Nähe des Γ -Punktes. Δ ist die Spin-Bahn-Aufspaltung.

Halbleiter	$m_{\rm e}^{\star}/m$	$m_{\mathrm{el}}^{\star}/m$	$m_{\mathrm{et}}^{\star}/m$	$m_{ m lh}^{\star}/m$	$m_{ m hh}^{\star}/m$	$m_{\rm soh}^{\star}/m$	Δ (eV)
Si		0.19	0.98	0.16	0.49	0.24	0.044
Ge		0.081	1.59	0.043	0.33	0.084	0.295
GaAs	0.063			0.082	0.51	0.14	0.341
GaSb	0.041			0.04	0.4	0.15	0.80
GaP		1.12	0.22	0.14	0.79	0.25	0.08
InAs	0.023			0.026	0.41	0.16	0.41
InP	0.073			0.089	0.58	0.17	0.11
InSb	0.014			0.015	0.43	0.19	0.81

Spin-Bahn-Aufspaltung grundsätzlich bei schweren Atomen höher:

 $\Delta \sim Z^4$

Tabelle 10.3: Effektive Massen von Elektronen und Löchern sowie Spin-Bahn-Aufspaltung Δ für Si und Ge. Quelle: *Handbook Series on Semiconductor Parameters*, Vol. 1 and 2, edited by M. Levinstein, S. Rumyantsev and M. Shur, World Scientific, London (1996, 1999).



14. Intrinsische Halbleiter (30)

Intrinsische Leitfähigkeit: Freie Elektronen werden durch thermische Anregung vom VB ins CB erzeugt.

<u>Gesucht:</u> Konzentration der Ladungsträger n_c (Elektronen) im CB und p_v (Löcher) im VB, die für die Transporteigenschaften von Halbleitern von zentraler Bedeutung sind.

$$n_C = \int_{E_C}^{\infty} D_C(E) f(E, T) dE \qquad p_V = \int_{-\infty}^{E_V} D_V(E) [1 - f(E, T)] dE$$

mit
$$D(E) = \frac{(2m)^{3/2}}{2\pi^2\hbar^3}E^{1/2}$$
 Zustandsdichte des freien Elektronengases pro Vol. und für beide Spinsorten

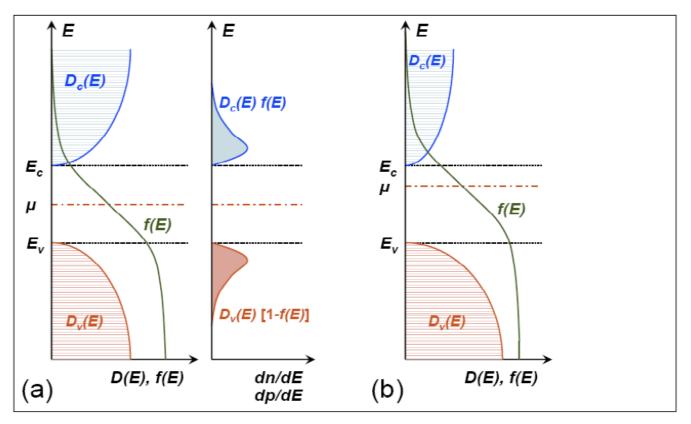
Hier für Parabelnäherung nahe der Bandkanten:

$$D_C(E) = \frac{(2m_e^*)^{3/2}}{2\pi^2\hbar^3} (E - E_C)^{1/2} \quad \text{für E} > E_C \quad D(E) = 0 \text{ für E}_V < E < E_C$$

$$D_V(E) = \frac{(2m_h^*)^{3/2}}{2\pi^2\hbar^3} (E_V - E)^{1/2}$$
 für E < E_V



14. Zustandsdichte intrinsischer Halbleiter (31)



Anzahl Elektronen im CB ist gleich der Anzahl der Löcher im VB ! (Neutralitätsbedingung)

Rechnung Intrinsische Ladungsträgerdichte

- (a) Falls $m_e^* = m_h^*$ und damit $D_c(E) = D_v(E)$, so liegt das chemische Potential μ genau in der Mitte der Energielücke
- (b) Falls $D_c(E) < D_v(E)$, dann verschiebt sich μ in Richtung CB-Kante, so dass die Integrale n_c und p_v gleich sind



Intrinsische Ladungsträgerdichte

$$n_{c} = \frac{A_{nzahl} Ladurströger}{Vilumen} = \frac{1}{V} \int_{E_{c}}^{\infty} dE D_{c}(E) \cdot f(E_{1}T) = \int_{E_{c}}^{\infty} dE g_{c}(E) \cdot f(E_{1}T)$$

$$e^{-\frac{E-\mu}{K_{0}T}} \approx \frac{1}{e^{(E-\mu)|K_{0}T} + 1} \frac{(2m_{0}^{2})^{2}}{2Tr^{2}h^{3}} \sqrt{E-E_{c}} = \frac{E_{1}ehtronen-madde}{Eehtronen-madde}$$

$$f \in E = C \text{ und } \text{ in weith entirent} = \frac{1}{V_{0}} \int_{V_{0}}^{\infty} dE \sqrt{E-E_{c}} - e^{-\frac{E}{2}h_{0}T}$$

$$n_{c} \approx \frac{1}{2\pi r^{2}} \left(\frac{2m_{0}^{*}}{h^{2}}\right)^{3/2} \cdot e^{\frac{K_{0}T}{K_{0}T}} \int_{A} k_{0} T \sqrt{k_{0}T} e^{-\frac{E}{2}E} \right) Ax = \frac{AE}{K_{0}T}$$

$$\Rightarrow n_{c} \approx \frac{1}{2\pi r^{2}} \left(\frac{2m_{0}^{*}}{h^{2}}\right)^{3/2} e^{\frac{E}{K_{0}T}} \int_{A} k_{0} T \sqrt{k_{0}T} e^{-\frac{E}{2}E} \right) Ax = \frac{AE}{K_{0}T}$$

$$= \frac{1}{2\pi r^{2}} \left(\frac{2m_{0}^{*}}{h^{2}}\right)^{3/2} \left(k_{0}T\right)^{3/2} e^{-\frac{E-\mu}{K_{0}T}} \int_{A} k_{0} T \sqrt{k_{0}T} e^{-\frac{E-\mu}{K_{0}T}} e^{-\frac{E-\mu}{K_{0}T}} \right) Ax = \frac{1}{2\pi r^{2}} \left(\frac{2m_{0}^{*}}{h^{2}}\right)^{3/2} \left(k_{0}T\right)^{3/2} e^{-\frac{E-\mu}{K_{0}T}} e^{-\frac{E-\mu}{K$$

ab E=Ec (Nullpunhty verschiebung gegenüber Kap.4)

Somit $n_c = n_0 e^{-\frac{4c-\mu}{K_BT}}$ mit $n_0 = n_0(T)$, aber vergleichsweise schwach temperaturabhängig Analog ergibt sich $PV = PO e^{-\frac{\mu - EV}{k_B T}}$ nit $PO = 2 \left(\frac{m_h^* k_B T}{2\pi k^2}\right)^{3/2}$ Für den intrinsischen Halbleiter gilt nc = Pv für alle Temperaturen! Interpretation der Exponentialterme: Boltzmann-Fahtur, d.h. thermische Anvegung über eine Energiebarriere 1E gemäß e AE mit 1E>0 $\rightarrow n_c: \Delta E = E_c - \mu > 0$ $Pv: \Delta E = \mu - E_v > 0$ Das chemische Potential liegt in der Bandlüche: Ec > M > Ev Rechnung: nc = pr setzen u. nach m auflösen Ergebnis:

 $\mu = \mu(T) = \frac{E_c + E_v}{2} + \frac{3}{4} k_B T ln \frac{m_h^*}{m_e^*}$

14. Extrinsische Halbleiter (32)

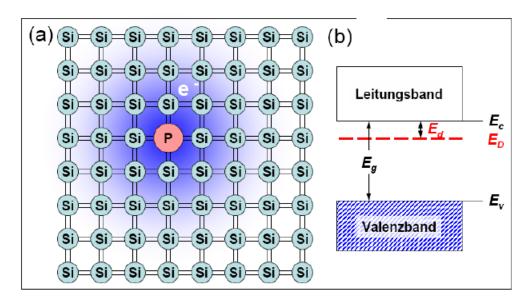
Extrinsische Halbleiter = dotierte Halbleiter

Die intrinsische Ladungsträgerdichte in Halbleitern ist für viele Anwendungen zu gering

⇒ müssen Dotieratome (elektrisch aktive Störstellen) einbringen

(a) n-Dotierung, Donatoren

Si: tetraedrische Koordination mit 4 kovalenten Bindungen; bringen in Si-Gitter ein 5-wertiges Atom (P, As oder Sb) ein → es bleibt ein überschüssiges Valenzelektron ausserhalb der sp³-Hybridbindung



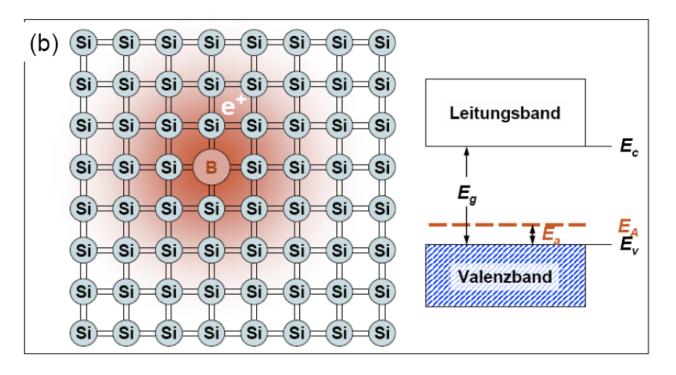
- E_D: Grundzustand des Donatoratoms
- E_d: Inonisierungsenergie des Donatoratoms, um Elektron ins CB anzuregen



14. Extrinsische Halbleiter (33)

(b) p-Dotierung, Akzeptoren

Bauen ein 3-wertiges Fremdatom (B, Al, Ga, In) ins Si-Gitter ein → der sp³-Hybrid kann ein zusätzliches Elektron aus dem VB unter Erzeugung eines Defektelektrons (Lochs) aufnehmen (Akzeptor).





14. Extrinsische Halbleiter (34)

Berechnung der Energieniveaus der Dotieratome: Bohrsches Atommodell ist ausreichend!

Bohrsches Atommodell

Wasserstoffatom
$$E_n^H = \frac{me^4}{2(4\pi\epsilon_0\hbar)^2} \frac{1}{n^2}$$

n=1 Ionisierungsenergie: 13.6 eV (sehr gross!)

In Materie: a) m → m*

b) Abschirmung des Coulombpotentials durch Dielektrizitätskonstante ε

$$\Rightarrow E_n = \frac{m_e^* e^4}{2(4\pi\varepsilon\varepsilon_0 \hbar)^2} \frac{1}{n^2}$$

Si:
$$m_e^* \cong 0.3 \; m_0$$
, ϵ = 11.7 \Rightarrow $E_1 \sim 30 \; meV$

$$E_d = E_C - E_D \cong 30 \text{ meV} \sim k_B T (= 300 \text{ K}) \cong 25 \text{ meV}$$

Ge:
$$m_e^* \cong 0.12 \; meV$$
 , ϵ = 15.8 \Rightarrow E₁ ~ 6 meV



14. Extrinsische Halbleiter (35)

Bohr-Radius des Donatoratoms:
$$r_d = \frac{4\pi\varepsilon\varepsilon_0\hbar^2}{m_e^*e^4}$$

mit
$$r_d = \frac{\mathcal{E} \cdot m_0}{m_e^*} r_{Bohr}$$
, $r_{Bohr} = 0.53 \,\text{Å}$

Achtung: Wirkung von Donatoren und Akzeptoren kann sich aufheben!

Kompensierte Halbleiter: Donatoren und Akzeptoren im Halbleiter,

Elektron eines Donators kann zu Akzeptor diffundieren und dort das fehlende Elektron ersetzen → Wirkung von Donatoren und Akzeptoren heben sich gegenseitig auf



14. Extrinsische Halbleiter (36)

Thermische Ionisierung dotierter Halbleiter:

Elektron im dotierten Halbleiter ist thermisch aktiviert entweder aus dem Valenzband oder von einem Donatorniveau; analog für Loch

Dichte aller vorhandenen Donatoren N_D bzw. aller Akzeptoren N_A ist gegeben durch die neutralen (N_D^0, N_A^0) und die ionisierten (N_D^+, N_A^-) Donatoren bzw. Akzeptoren:

$$N_{D} = N_{D}^{0} + N_{D}^{+}$$

$$N_{A} = N_{A}^{0} + N_{A}^{-}$$

Summenregeln

Lage des Fermi-Niveaus im homogenen Halbleiter ist festgelegt durch die Neutralitätsbedingung

$$n + N_A^- = p + N_D^+$$

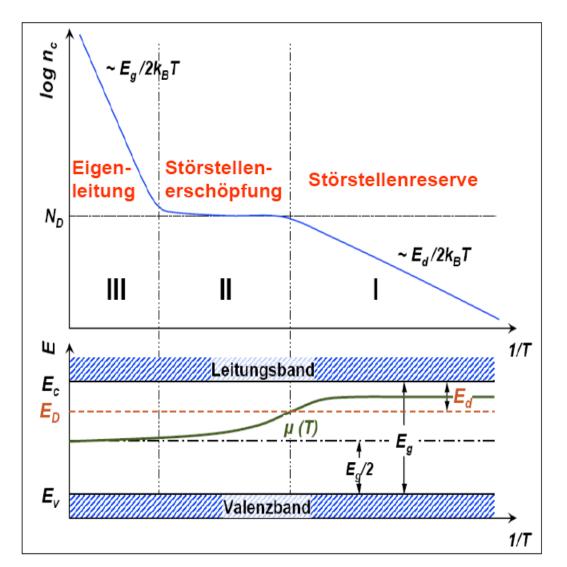
Betrachten reinen n-Halbleiter, in dem nur Donatoren vorhanden sind. Für die Besetzung der Donatorniveaus mit Elektronen gilt:

$$n_D = N_D^0 = N_D \frac{1}{\exp\left(\frac{E_D - \mu}{k_B T}\right) + 1}$$
 Fermi-Dirac-Statistik



14. Extrinsische Halbleiter (37)

Dotierter Halbleiter: Temperaturabhängigkeit der Ladungsträgerdichte und des chemischen Potentials



Rechnung hierzu im Sommersemester



14. Ausblick: weitere Halbleiter-Materialen (38)

Organische Halbleiter:

 z.B. Polyacetylen; Anwendungen: OLEDs (Organic Light Emitting Diodes),
 OFETs (Organic Field Effect Transistors); Herstellung preiswert; leicht modifizierbar hinsichtlich elektr. u. opt. Eigensch., aber Haltbarkeitsproblem.

Oxidische Halbleiter:

- CuO, CuO₂, ZnO
- La₂CuO₄ (E_g≅ 2 eV), wird durch Lochdotierung mittels Ba oder Sr metallisch und supraleitend für T<T_c≅ 40K! La_{2-x}Ba_xCuO₄ war Ausgangsmaterial für die Entdeckung der Hochtemperatur-Supraleiter durch G.Bednorz und K.A. Müller (1986)

Schicht-Halbleiter:

 Pbl₂, MoS₂, GaSe; Bindung innerhalb der Schichten kovalent, dazwischen van der Waals Bindung; intrinsisch 2D Elektronensysteme; Variation der Kopplung zwischen Schichten durch Interkalation (Einbringung von Fremdatomen)

Magnetische Halbleiter: hohes Interesse wegen Anwendung als Injektoren für spinpolarisierte Ströme in Halbleiter (Spinelektronik)

- EuO (T_c=69 K), EuS (T_c=16 K)
- Ga_{1-x}Mn_xAs (T_c≅ 170K) → DMS (diluted magnetic semiconductors)
- $Zn_{1-x}Mn_xO$

